【19】中華民國　　【12】發明公開公報　(A)

【11】公開編號：202015745　　申請實體審查：有

【43】 公開日：中華民國 109 (2020) 年 05 月 01 日

【51】Int. Cl.：　***A61L15/22　(2006.01)***　***A61L15/42　(2006.01)***
A61L15/46　(2006.01)　***D06M10/10　(2006.01)***
A61P17/10　(2006.01)

【54】發明名稱：具修復面皰之高分子敷材及其製備方法

【21】申請案號：107137017　　【22】申請日： 中華民國 107 (2018) 年 10 月 19 日

【72】發 明 人： 李佳芬 (TW) LEE, CHIA FEN；許茂松 (TW) HSU, MAO SUNG；呂昆霖 (TW) LEU, KUEN LIN；詹喬宇 (TW) CHAN, CHIAO YU

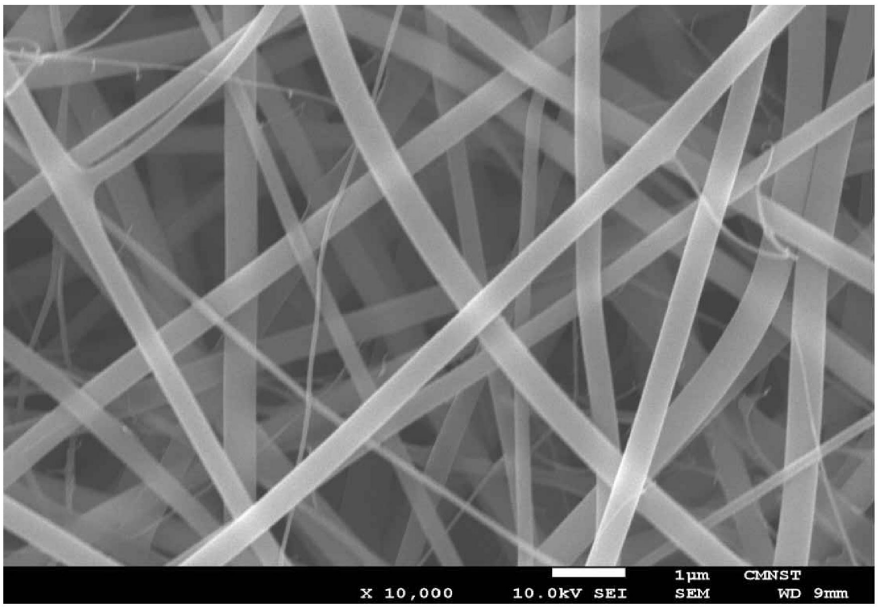
【71】申 請 人： 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 CHIA NAN UNIVERSITY OF PHARMACY & SCIENCE
臺南市仁德區二仁路 1 段 60 號

【74】代 理 人： 陳豐裕

【57】發明摘要：

本發明有關於一種具修復面皰之高分子敷材及其製備方法，所述製備方法包括：配置含 0.1%~10%甲基纖維素鈉(Sodium carboxymethyl cellulose)的水溶液，作為一第一溶液；取 1 克的 poly(N-isopropylacrylamide-co-N-methylolacrylamide)和 0.5~10 克純水溶液混和均勻並完全溶解，以形成一第二溶液；將 0.2-2 克的第一溶液與第二溶液混合均勻；利用靜電紡絲製成一電紡纖維，以得到一奈米纖維，取厚度為 10nm-100nm 之奈米纖維以得到一具修復面皰之高分子敷材；藉此，本發明之高分子敷材具有抗菌、高透氣性、高舒適性、美觀之效果，可提升面皰修復。

指定代表圖：



第　一　圖